

Установка атомно-слоевого осаждения **Classic**



Производитель:

CN1

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка Classic предназначена для процессов термического атомно-слоевого осаждения (TALD - Thermal Atomic Layer Deposition) тонких пленок. Конфигурация установки позволяет работать с пластинами диаметром до 200 мм, а также прямоугольными подложками. Загрузка образцов в камеру осуществляется в ручном режиме. Имеется встроенная система подачи прекурсоров и рабочих газов. Управление системой осуществляется при помощи цветного сенсорного дисплея. Опционально доступна автоматическая загрузка пластин из кассеты или кластерная конструкция с несколькими модулями. Установка атомно-слоевого осаждения Classic является бюджетным и надежным решением для научно-исследовательских центров и лабораторий.

Область применения

- Нанoeлектроника: осаждение оксидов, нитридов, металлов, барьерных и seed слоев.
- Новые разработки в области сенсоров, НЭМС, МЭМС, графеновых транзисторов, OLED.
- Оптические покрытия для фильтров УФ - ИК диапазона.
- Осаждение защитных и коррозионностойких покрытий.

Особенности

- Конструкция рабочей камеры с горизонтальным потоком прекурсоров обеспечивает высокую равномерность по толщине пленки.
- Рабочая камера из алюминия для одиночной обработки пластин или прямоугольных подложек
- Регулируемая температура подложки 25 - 400°C.
- До 4 линий подачи прекурсоров и рабочего газа.
- Простой и понятный графический интерфейс пользователя на базе PLC и сенсорного дисплея для задания параметров технологического процесса (рецептов).
- Простое сервисное обслуживание благодаря модульной конструкции установки.
- Опционально доступен встроенный генератор озона (O3).
- Совместимость с условиями чистых помещений.